

Doc.No : NR981125

1998年11月25日

1 ギガの半導体開発製造用 マスク線幅測定装置「Leica LWM250UV」を発売

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区/社長：石田 明)は、ライカ・マイクロシステムズ社 (= Leica Mikroskopie Wetzlar GmbH、本社：ドイツ・ヴェツラー市)製の1ギガの半導体開発製造用マスク線幅測定装置「Leica LWM250UV」の輸入販売ならびに技術サポートを1998年11月25日から開始します。なお、12月2日から4日まで千葉県幕張メッセで開催される展示会「セミコンジャパン」にパネル展示を行います。

この度の「Leica LWM250UV」の発売は、1992年11月にライカグループ (= Leica Microscopy and Scientific Instruments Group、本社：ドイツ・ヴェツラー市/代表：H. ウエグナー氏)と締結した業務提携に基づくもので、当社は既に同グループのマスク座標測定装置、ウエハ外観検査装置やマスク線幅測定装置などを日本国内で販売し技術サポートを行っています。

マスク線幅測定装置は、半導体を製造する際の原版となるマスクに描かれた回路パターン原画の線幅を測定する装置で、マスクの開発や製造工程でのマスクパターンの現像評価、エッチング評価、最終仕上がり評価に用いられます。半導体の集積度の高まりとともに回路パターンの超微細化が進み、マスク線幅に要求される精度もこれまで以上に厳しいものになっています。

「Leica LWM250UV」は、「Leica LWM200」の後継機で、光学系に世界最高水準の顕微鏡「Leica INM200UV」を搭載し、i線の波長(365ナノメートル)領域を利用して0.2マイクロメートルの解像度を可能にしました。これにより1ギガの半導体開発製造に求められる精度を十分にクリアしています。

光源や対物レンズも幅広く準備しており、透過・反射測定はもとより、ペリクル(異物付着を防ぐための透明な保護膜)付マスクの線幅測定にも対応しています。標準装備の透過光源用コンデンサレンズは、マスクの厚みに合わせて自動調整できます。

操作はWindowsパソコンで行い、エッジ分析、Dot & Hole測定、Memory測定、面積測定、エッジカウントなどの測定プログラムを選択し、容易かつスピーディーなオペレーションが可能です。

< 国内標準販売価格・消費税別 >

8,500万円～9,500万円(オプション別売)

< 販売予定数 >

年間20台

<仕様>

用途:	マスクパターンの測長
照明:	透過ハロゲン光及び水銀光、反射ハロゲン光、コンフォーカル用水銀光
対物レンズ:	×2.5、×10、×20、×100、×150、×150(i線用) (標準レンズを6本搭載。下記オプションレンズが必要な場合は標準レンズとの交換要。)
オプションレンズ:	×50、×50(LWD)、×250
ステージサイズ:	8インチ×8インチ(可動範囲6インチ×6インチ)
測定範囲:	0.2 μm ~ 200 μm
測定保証最小線幅:	0.5 μm(ペリクル付マスク/0.8 μm)
ステージ精度:	0.5 μm(ソフト補正使用)
クリーン度:	クラス1
測定再現性:	4nm(3) 未満 短期再現性(i線モード) 6nm(3) 未満 長期再現性(i線モード) 5nm未満(White lightモード) 8nm未満(White lightモード)
スクリーンリアリティー:	10nm未満 20×20 μm範囲(i線モード)



解像度0.2マイクロメートルを実現した
マスク線幅測定装置「Leica LWM250UV」

この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。
(<http://www.screen.co.jp/press/photo.html>)